ホルミウム多価イオンの発光線の観測

中村信行研究室 島谷太一

1. 序論

今日までの物理学は、物理定数を不変と みなしたうえで様々な現象を定義してきた が、近年その物理定数が変化していること が示唆されており、その一つが微細構造定 数($\alpha = e^2/\hbar c$)である[1]。 α の経年変化を確 かめる方法の一つに、光学遷移周波数の精 密測定がある。最新の実験では、 α 依存性 の異なる Al⁺と Hg⁺の遷移周波数を比較する ことで、 α の値が 10⁻¹⁷/年程度の範囲で変化 しないことが実証された[2]。

さらに高い精度でαの経年変化を探るため、多価イオンを使った遷移周波数の精密 測定が注目されており[3]、中でもHo¹⁴⁺は可 視領域に有用な遷移をもつとしてα変動検 知実験への利用が提案されている[4]。

Dzubaらにより該当の遷移周波数が理論的 に求められたが[4]、無数の微細構造準位を もつ複雑な多電子イオンのエネルギー準位 を正確に計算するのは容易ではないため、 実験による検証が必要となっている。

そこで本研究では、多価イオン源である 電子ビームイオントラップ(Electron Beam Ion Trap : EBIT)を用いてHo多価イオンの分 光測定をし、Ho¹⁴⁺の可視領域遷移の探索を 行った。

先行研究[5]では、発光線の帰属イオンを 正確に同定するため、発光線観測と同時に 飛行時間測定を行い、EBITで生成されたイ オンの価数分布が測定された。この価数分 布と発光線強度の電子ビームエネルギー依 存性を比較することにより、Ho¹⁴⁺が支配的 に生成される電子ビームエネルギーの決定 及びその発光線が観測された。

本研究では、先行研究で観測されたHo¹⁴⁺ の発光線の遷移準位を同定することを目的 とし、Ho¹⁴⁺の発光線の電子ビームエネルギ 一依存性を細かく測定した。

2. 実験装置

2.1 電子ビームイオントラップ

Ho 多価イオンは、図1で示した小型 EBIT (Compact EBIT: CoBIT)で生成した。EBIT は、電場によってイオンを閉じ込め、そこ に電子ビームを衝突させて価電子を逐次的 に電離させることで多価イオンを生成する。 トラップ領域に導入された原子は電子ビー ムの衝突を受けてイオン化し、ドリフトチ ューブ(Drift Tube: DT)と呼ばれる円筒電極 が作る井戸型ポテンシャルと電子ビームが 作る空間電荷ポテンシャルで3次元的に閉 じ込められる。生成された多価イオンの発 光線は、トラップ領域に設けられたスリッ トより観測される。



図1:電子ビームイオントラップの概略図

2.2 可視分光器

本実験で用いた可視分光器の配置図を 図2に示す。DT内のイオントラップ領域で 生成された多価イオンからの発光はCoBIT 外に取り付けられた両凸レンズでスリット に集光され、そこから2つの凹面鏡と回折 格子を経由してCCDカメラに結像される。 検出する光の波長領域は、回折格子を回転 させることで調節した。



図2:可視分光器の配置図[5]

Ho¹⁴⁺の発光線強度の電子ビーム エネルギー依存性

電子ビームエネルギー $E_e \approx 260 \sim 290 \text{eV}$ における Ho¹⁴⁺の励起過程は、(A)Ho¹⁴⁺の基 底状態から励起する場合と(B)Ho¹³⁺の基底 状態から電離と同時に励起する場合が主に 考えられる。図3はHo¹⁴⁺が可視光線を放出 する過程をエネルギー準位図を用いて模式 的に表したものである。図中の $I_n(n = 13,14)$ はイオン化エネルギー、 E_e は電子ビ ームエネルギー、(A)',(A)"と(B)'はそれぞ れ過程(A)と(B)で励起した電子が脱励起す る過程である。



図3:Ho¹⁴⁺が可視光線を放出する過程

励起過程(A)において、 $E_e \approx 260 \sim 290 \text{eV}$ の電子ビームの衝突を受けた電子は、 Ho^{15+} の基底状態付近の高エネルギー準位まで励起される。そこから、放射遷移によって脱励起する際、遷移確率が遷移周波数の3乗に比例することを考慮すると、多過程(A)で励起した電子は低エネルギー準位に達するまでの脱励起過程(A)、で可視光線を放出する可能性が低い。脱励起過程(A)、でエネルギーの大きい遷移により紫外領域発光線を放出した電子は、その後低エネルギー準位間の遷移で可視領域発光線を放出すると考えられる。

一方、励起過程(B)で $E_e \approx 260 \sim 290 \text{eV}$ の 電子ビームの衝突を受けた電子は、 Ho^{14+} の 基底状態からおよそ $0 \sim 30 \text{eV}$ の低エネルギ 一準位に励起する。過程(A)と異なり、低エ ネルギーの励起準位にある電子はエネルギ ーの大きい遷移を起こせないため、低エネ ルギー準位間の遷移(B)'で放出する発光線 は可視光領域である可能性が高い。

ここで、2 つの発光過程について電子ビ ームエネルギー依存性を考える。 図 3 では省略されているが、7 つの価電 子をもつHo¹⁴⁺は無数の励起準位を持つた め、過程(A)で高エネルギー準位まで励起し た電子は、過程(A)'で無数の中間準位を経由 しながら脱励起する。よって、電子ビーム エネルギー *E*e が変化して励起準位が多少 変わったところで、最終的に過程(A)"で放 出される可視領域発光線の強度は電子ビー ムエネルギー依存性を示さないと考えられ る。

対して、Ho¹⁴⁺の低エネルギー準位に励起 する過程(B)では、E_eの変化に伴って遷移 (B)'の上準位が 5eV ずつ上昇する。これに より起こりうる遷移(B)'も変化するため、可 視領域発光線の強度に電子ビームエネルギ 一依存性が現れると考えられる。すなわち、 観測される可視光線強度の電子ビームエネ ルギー依存性は、主に遷移(B)'に起因するも のである。

以上を踏まえて遷移過程(B)'のみを考え る。図4は、Ho¹⁴⁺の低エネルギー準位を 模式的に表した図である。図4(a)に示した ように、エネルギー準位において相対的な 位置が異なる2つの遷移では、電子ビーム エネルギーの変化に対して、発光強度が図 5(a)のようになると予想できる。一方、図4 (b)に示したように、相対的な位置が近い2 つの遷移は、電子ビームエネルギーに対す る発光線の強度変化が図 5(b)のようになる と考えられる。



図4:Ho¹⁴⁺の低エネルギー準位間で起こる遷移



図5:発光線強度の電子ビームエネルギー依存性

測定を行った 359-645nm でHo¹⁴⁺の発光 線強度について電子ビームエネルギー依存 性を調べたところ、以上で予想したような 電子ビームエネルギー依存性を示す発光線 がいくつか確認された。図 6,図 7 はその一例 で、図 8, 図 9 はそれぞれの発光線強度を電 子ビームエネルギーの関数としてグラフに したものである。図 8 では、発光線強度の 電子ビームエネルギー依存性が図 5(a)のよ うな挙動を示している。これらは、遷移同 士がエネルギー準位において相対的に異な る位置関係にあると考えられる組である。 また、図 9 は、図 5 (b)のような挙動を示した 発光線の組である。これらは、遷移同士が 相対的に近い位置関係にあると考えられる。



図 6:617-640nm における Ho 多価イオンの発光線



図7:406-417nm における Ho 多価イオンの発光線





ビームエネルギー依存性

4. まとめと展望

本研究では、Ho¹⁴⁺の発光線の電子ビーム エネルギー依存性を調べることで、いくつか の発光線について遷移同士のエネルギー準 位における相対的な上下関係を知ることが できた。

今後は、電子ビームエネルギー依存性を調 べる方法以外でHo¹⁴⁺の遷移を探索しよう と考えている。

参考文献

- [1] J.-P. Uzan, Rev. Mod. Phys. 75, 403 (2003).
- [2] T. Rosenband et al, Science 319, 1808 (2008)
- [3] J. C. Berengut, V. A. Dzuba, V. V.Flambaum, Phys. Rev. Lett, 105,120801(2010)
- [4] V. A. Dzuba, V. V. Flambaum, Phys. Rev. A, 91,022119 (2015)
- [5] 中島貴之 卒業論文, 電気通信大学 (2014)